

**EV GROUP Advances Leadership in Optical Lithography With Next-generation EVG150 Resist Processing Platform – November 10, 2022**

**EV Group透過次世代EVG150光阻製程平台 擴大在光學微影領域的領先優勢**

本文作者: EV Group 點閱: 201 2022-11-10 13:02

**摘要:**

經過重新設計的200毫米平台提升機動靈敏度以達到更高的製程產出。透過降低高度降低設備的佔地面積，同時維持在一世代平台引領業界的功能。

2022年11月10日 - 微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的高級混合暨微影技術設備領導廠商EV Group (EVG)，今天宣布發表次世代200毫米版本的EVG150自動光阻製程系統，強化該公司的光學微影解決方案產品組合。重新設計的EVG150平台包括先進功能與優化項目，與前一代平台相比可提供更高的製程產出 (最多高出80%)、通用性，以及更小的設備佔地面積 (減少近30%)。EVG150在通用的平台上提供可靠且高品質的塗佈與顯影製程，可支援各種裝置與應用，包括先進封裝、微機電系統、無掩射蝕 (RF)、3D感測、功率光學以及光子光學。EVG150極高的製程產出、彈性與通用性，能支援大規模量產與工業開發所需的最高需求。



電子控制系統 (EBS) 產業的頂尖研究中心Silicon Austria Labs是第一個採用次世代EVG150製程的客戶。Silicon Austria Labs系統研究部門負責人Moham Modj博士表示：「早在工業4.0、物聯網、自動駕駛、虛實整合系統 (CPS)、人工智慧、智慧城市、智慧能源與智慧醫療等領域，我們就透過與引領業界的製造商共同研究，開發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG的次世代EVG150光阻製程系統的高產彈性，為我們客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎，並推動彼此的創新。」



#### 邁向平台提供前所未有的彈性

為200毫米基板設計的次世代EVO150保有前一代平台引領業界的功能，包括具有全自動化功能的可定制化的旋轉與噴霧式塗佈、顯影、烘烤與冷卻模組；EVO專有的Oxyspary®技術，可因應極端形狀的成膜塗佈；精密且超精確製造的機械化處理，具備卓越執行者可確保持續的高製程產出；以及晶圓塗佈、成形、蝕刻及蝕化晶圓的處理。

次世代EVO150 300毫米平台的全新功能包括：

- 最多達四個塗佈式製程模組的空間，以及高達20個快轉/冷卻單元，可以同時處理更多的晶圓。
- 獨立的光阻塗佈腔體使腔體間完全隔離，幾乎完全消除腔體間的文瓦污染。
- 模組經過進一步重新設計，可從設備外部更容易處理傾斜的腔體，獲得最小的停機時間，且在進行腔體保養時也可持續操作設備。
- 系統內部的腔體重新定義，以便更容易以機械化處理來進行保養。
- 具有影像功能的預對準系統，可以隨時進行晶圓量中速而加速製程。
- 整合系統內部的光阻與化學藥液管線，可以減少儲存化學藥液的外部櫃體空間，並降低設備的佔地面積。
- 將使用者介面整合於系統內，可以進一步降低設備的佔地面積。

EV Group企業經理暨Thomas Glaser博士表示：「光阻製程與圓形化基半導體製造中反覆進行多次的製程步驟，EVO已經針對這些製程累積了多年的經驗，包括光學微影、旋轉與噴霧式塗佈，以滿足最嚴苛的客戶需求。我們將這些經驗融入對次世代的EVO150系統中，這套系統經全面性的重新設計，可在邁向平台上提供突破性的製程產出與擁有成本效益，提供無與倫比的彈性，以滿足最廣泛的光阻製程需求。」

#### 產品供應時程

EVO已經開始接受各界對次世代EVO150自動化光阻製程系統的訂單。當在公司總部提供產品展示，更多相關資訊請瀏覽：<https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg150/>。

#### 關於EV Group (EVO)

EVO是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和激光科技應用的晶圓製程解決方案供應商，主要產品包括晶圓塗佈、晶圓蝕化、微影/奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVO成立於1990年，藉由一羣先備的全球製造商為全球客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：[www.EVGroup.com](http://www.EVGroup.com)。

<http://www.comptechasia.com/a/press/2022/1110/52697.html>